CLIPFEDIMAGE= JP360010756A

PAT-NO: JP360010756A

DOCUMENT -IDENTIFIER: JP 60010756 A

TITLE: MANUFACTURE OF BEAM-LEAD TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: January 19, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAWAMAKI, AKIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

NEC CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP58119143

APPL-DATE: June 30, 1983

INT-CL (IPC): H01L021/92

US-CL-CURRENT: 29/827,438/464 ,438/FOR.380

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the reliability and production yield remarkably by a method wherein, when pellets are separated from a flat plate by a pellet adsorbing jig, any wax adhering to pellets is melted by heating to be removed using hot organic solvent in a heated receiver.

CONSTITUTION: A semiconductor wafer 1 whereon specified beam-lead type element is formed is turned over to be bonded on a flat plate 4 made of quartz etc. using wax. Firstly resist pattern is formed on the backside of the wafer 1 and the wafer 1 is selectively etched by mixed acid solution utilizing the resist pattern as a mask to separate the wafer 1 into pellets 5.



MANUFACTURE OF SI Patent Number: JP59208756	IRE OF SEMICONDUCTOR DEVICE PACKAGE JP59208756
Publication date:	1984-11.27
Inventor(s):	AKIYAMA KATSUHIKO; others: 02
Applicant(s)::	SONY KK
Requested Patent:	☐ <u>JP59208756</u>
Application	JP19830083188 19830512
Priority Number(s):	
IPC Classification:	H01L23/12;H01L21/56;H01L23/48
EC Classification:	
Equivalents:	JP1760995C, JP4047977B
PURPOSE:To obtain a semicond wherein the semiconductor device substrate is selectively removed to CONSTITUTION:Au plating 12 of of 35mum thickness. A semicond 11i. The transfer-molding with episolution from the back surface 11	PURPOSE: To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for automated manufacturing by a method wherein the semiconductor device is mounted on a substrate and, after being connected to external electrodes, enclosed integrally with resin and the substrate is selectively removed by etching. CONSTITUTION: Au plating 12 of 1mum thickness, Ni plating 13 of 1mum thickness and Au plating 14 of 3mum are laminated on an Fe substrate 11 of 35mum thickness. A semiconducor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external electrodes 17, 18 on the portions 11h, 11i. The transfer-molding with epoxy resin 20 is carried out so as to make thickness te 1mm. The Fe substrate is removed by etching with FeC13 solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Au player and accounted to the Automate and the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Automate and the back surface to the Automate and the back s
12c and the heat radiation soldered to a conductor patt an easy and simple method.	urfac ern o
	Data supplied from the esp@cenet database - 12

BEST AVVILABLE COPY

Secondly the quartous plate of to mero the wax i and the pellets 5 are separated from the quartous plate 4 using a pellet adsorbing jig 6. Finally was 13 adhering to the wiring side and backside of pellets 15 may be removed by means of spraying organic solvent preliminarily heated by a neater 11 with a cleaning reserve. It wishes the pellets is are arrayed on an arraying plate 22.

COPYRIGHT: (C)1985, JPO& Japio

THE STAND OF STANDING OF

19 日本国特許庁 (JP:

我特許出願公開

12 公開特許公報 :A

四召60-10756

5t Int Cl * H 01 L 21 92 孤别記号

庁内整理番号 7638 5王 43 公開 - 834060年(1985) 1 月19日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

34ビームリート型半導体装置の装造方法

2144

約 8258 119143

22出

類 服58(1983)6月30日

拉発 明 者 鞭卷原题

東京都港区芝五丁[133番)号日 本電気株式会社内

51出 · 随 7、 日本電気株式会社

東京都港区芝方丁目33番1号

每代 理 人 弃理士 内原晋

8D 148 T

1. 强明の名称

ビーエリード型半週体装貨の製造方法

2. 特別無米の転送

ピームリード型半導体工子の形成されたウェハーを裏面してファクスで平板に貼り付ける工程と、 前記ウェハーを裏面から選供的にエッテング除去 してペレットに分配する工程と、前記ファクスを 常しペレット吸引用始長にて前記平板から前記ペ レットを分限する工程と、前記ペレットに付着し ているファクスを、切められた批浄用受け皿内に て、暖めた有機筋関によってリックスを除去する 工程とを含むことを前なとするピームリード製学 媒体機体の製造方法。

3 9 9 19 17 46 46 6 77 99

本項明は6-29、ドルキの体が4を6の参照方法 に関する。 従来ビーエリード型半導体装置の製造方法は、 所限のビーエリード型半導体製子の形成された半 導体系板の上面にリックスを患者し石英板と辿り 合せし後、無半導体状程の質節にレジストにてパ ターンを形成し机能能で半薄体のマハーを選択的 にエッチンク終去してペレット性の分割し、内にペレット1個でつか減して再配列する力に100~ 200℃の環境のホットプレート上でワックスをだ しペレット数が用的具にてペレットと石英板とを 分割後、半導体ペレットに付着ワックスをデめ加 熱ヒーターで有機器割を除めた有機器割をスプレーガンで3~5分間吹付けて除去し畑の配列板に

しかし上記得求のベレットハンドリングデサビ ロ、以下に述べるような欠かがあった。

ベレットハンドリングする場合はベレットと石 夢切とがウェクスによって貼り合わさっておりと のフェクマを100~200での配置のホットプレ ート上で石裏板と埋めてフェクスを描かし、ベレ ェトのポリー月にてベレットと石裏板とを分配は、

- 2 -

平海はペレッ!の配射面がび其れに付着している ワックスを、50~100℃の似度動性のが終ヒ ーターにて予め有機用型を繋めスプレーガンで吹 付料30~35℃範囲の有機容割を3~5秒間吹 付けてワックスを除去し別の配列板に並べている がペレットサイズによってワックス洗浄に時間が かかりまたワックスが完全に取りまれない場合も あった。

ペレットの前向市及び終品にワックスが残っていると、ペレットの何期当及び歩割りを割りし込ペレットサイズによってペレットハンドリングの死移的間を投くしたりするため作業能率を懸くする欠点を持っていた。

一本契明は上制作点を除去し半導体装削の保険性 及び製造水像とを大幅に関出させることのできる 単調体装置の製造力法を提供するものである。

本発明の特徴は、ビームリード製半導体数子の 形成されたウェハーを表落してワックスで平板に 貼り付けする工程と、前記ウェハーを展開から設 択的にニッテング除去してペレットに分割する工

- 3 -

貫する。

次には3箇に示すようにペレット15の配領所 及び契請に付加しているファクス13を50~ 100で減度範囲の加熱ヒーター21によって予 め有機器制と、洗作用で加186加熱ヒーター 19によって50~100での減減範囲で加熱し、 スプレーガン20で吹付的35~40で結構の有 機器調を3~4秒間吹付けてワックスを除去した (第4日 後、別の紀列後22上にペレット15を配列する。

上記のように本住明方法によればペレットの配 製商及び州西に付着しているワックスを予め殴め た有機冷制と庇伊川受け期もWのふことにより有 機管制実属自てペレットに吹付ける事が出来るた め、短時間でワックスが脚去でき、しかもペレットにワックスが設ることなく、製造歩行り及び製 品の信頼性が良くなり、しかもペレットサイズに 観信なく短時間でペレットパンドリングが可能に なる。

4. 図前の世界カルリ

程と、か新によりフェックタをロップレット系の出 向身にでもないられたが、そのはてるよりで、 前記のレートにいかしているリックスを、既めら の大量は回収には、謎めたお拇が初れて統立する 工程と、前がベレットを配列する工程とを含む出 身体報をの製作力がある。

以下東部伊州共づき四面を対例して年を明を計 面に初明する。

まず他)はに・するかは、原子のビースリード 動ま子の形成された単導体ウェバー」を、前にビ ーエリードでが下にかるように裏裏して、例えば スカイコートなどのワックス3を用いて石英など の子数々に辿り付ける。

たけれ続けるはいュハートの仮倒にレジストパターンを単位し、マパターンをマスクにして存在表を用いて数でュハーを選択的にエッテンク所力し、銀2分に示すようにペレット5に分離する。 次に100~200℃のホットブレート7の上で石英板4を望めてワックス3を終かしペレット既新用的具6を用いてペレット5を石英板4から分

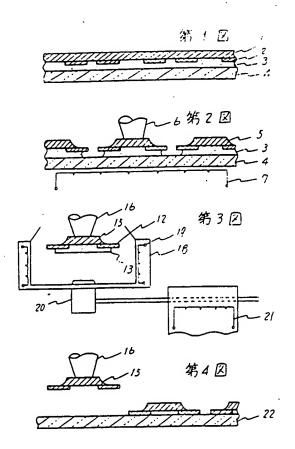
第1回乃至第4回は本晃明の実施例を説明する 為の断面図である。

1 ……半初体ウェハー、2 . 1 2 ……ビームリード、3 . 1 3 ……ワックス、4 ……石灰板、5 . 1 5 ……ベレート、6 . 1 6 ……ベレット吸石用 竹具、7 ……ホットブレート、1 8 ……旅を用受け皿、1 9 ……旅を用受け皿の加熱セーター、2 0 ……スプレーガン、2 1 ……有数形態の加熱セーター、2 2 2 ……ガラス似てある。

代班人 乔坪士 內 旅



, iku i serri bi in Ario



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.